

関係各位

2022年7月21日

株式会社パテント・リザルト

## 【半導体製造装置】他社牽制力ランキング 2021

### トップ3は東京エレクトロン、SCREEN、AMAT

弊社はこのほど「半導体製造装置業界」の特許を対象に、2021年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計した「半導体製造装置業界 他社牽制力ランキング 2021」をまとめました。

この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。

集計の結果、2021年に最も引用された企業は、1位 東京エレクトロン、2位 SCREENホールディングス、3位 APPLIED MATERIALSとなりました。

#### 【半導体製造装置業界 他社牽制力ランキング 2021 上位10社】

順位	企業名	引用された特許数
1位	東京エレクトロン	825
2位	SCREENホールディングス	441
3位	APPLIED MATERIALS	234
4位	ディスコ	224
5位	アルバック	165
6位	東京精密	150
7位	芝浦メカトロニクス	135
8位	キヤノンアネルバ	98
9位	アドバンテスト	96
10位	LAM RESEARCH	95

#### 【ランキングの集計対象について】

日本特許庁に特許出願され、2021年12月までに公開されたすべての特許のうち、2021年1月から12月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2022年4月15日の時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。なお業種は、総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。

1位 東京エレクトロンの最も引用された特許は「シリコンウェハ等の基板に付着したパーティクルを除去する性能が高い基盤洗浄システム」に関する技術で、SCREENホールディングスとJSRの計4件の審査過程で引用されています。このほかには「基板容器からの蓋体の着脱、蓋体が取り外された基板容器からの基板の出し入れが可能なロードロック装置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、APPLIED MATERIALSなどの計3件の拒絶理由として引用されています。

2021年に、東京エレクトロンの特許による影響を受けた件数が最も多い企業はAPPLIED MATERIALS(82件)で、次いでSCREENホールディングス(80件)です。

2位 SCREENホールディングスの最も引用された特許は「画像検査装置及びその再印刷指定方法およびそれを備えた印刷装置」に関する技術で、コニカミノルタの計3件の審査過程で引用されています。このほか「対象面の表面形状を考慮し、適切な3次元軌道を生成する3次元軌道生成装置」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、センシンロボティクスなどの計3件の拒絶理由として引用されています。

2021年に、SCREENホールディングスの特許による影響を受けた件数が最も多い企業は東京エレクトロン(72件)で、次いでコニカミノルタ(11件)です。

3位 APPLIED MATERIALSの最も引用された特許は「リソグラフィマスクの用途のためのホウ素リッチ膜のエンジニアリング」に関する技術で、東京エレクトロンの計4件の審査過程において拒絶理由として引用されています。

2021年に、APPLIED MATERIALSの特許による影響を受けた件数が最も多い企業は東京エレクトロン(31件)で、次いでLAM RESEARCH(12件)となっています。

4位 ディスコは「デバイスの品質および抗折強度を低下させない、ウェーハの分割方法」、5位 アルバックは「ワークの保持力を確保しつつ粘着層の貼り替えを容易に行える表面処理用のワーク保持体」が、最も引用された特許として挙げられます。

\* \* \*

また弊社では、ランキングデータを下記の通り販売しています。

#### 【半導体製造装置業界 他社牽制力ランキング 2021 データ】

▶納品物：以下のデータを収納した CD-ROM

- ・ランキング トップ 30 社：本業界の被引用件数上位 30 社のランキング
- ・被引用件数 トップ 100 件：本業界の被引用件数上位 100 特許、及び引用先の特許との対応

▶価格：50,000 円（税抜）

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パテント・リザルト 事業本部営業グループ

TEL : 03-5802-6580 FAX : 03-5802-8271 HP : <https://www.patentresult.co.jp/>